

高纯度Ptfе溢流酸洗槽一体化无缝聚四氟乙烯实验室清洗槽

货号: PL-CP32



简介

工程高纯度PTFE溢流槽，采用一体化无缝结构，用于强化化学酸洗。这些耐用的无焊缝槽确保零泄漏和卓越的耐化学性，满足苛刻的半导体和工业实验室应用需求。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
半导体晶圆蚀刻	用于从硅晶圆上去除薄膜和氧化层的高纯度酸浴。	零痕量金属污染和精确的溶液浓度控制。
太阳能电池绒面制备	对太阳能级硅进行大规模化学处理，以增强光吸收性能。	对侵蚀性绒面试剂具有化学抵抗力和长期耐用性。
精密金属酸洗	去除航空航天和医疗级特种合金的表面杂质和氧化皮。	承受浓酸混合物而无结构降解。
痕量分析制备	在恒流高纯度酸环境中清洗实验室玻璃器皿和传感器。	超低背景噪声并防止分析物吸附。
制药清洗	使用强效杀菌剂对高纯度组件进行灭菌和清洗。	光滑、无孔表面防止细菌滋生和化学残留。
电池研究	在腐蚀性电解质中测试电极材料，用于锂离子和液流电池开发。	完全化学隔离并防止电解质引起的泄漏。
电镀浴	为特种金或铂电镀工艺提供稳定、非反应性容器。	消除来自槽体材料的电化学干扰。
化学品储存	长期容纳超纯试剂，要求零接触金属或玻璃表面。	在长期储存期间保持试剂等级。

特性	规格详情 (型号: PL-CP32)
基础材料	100% 原生高纯度 PTFE (聚四氟乙烯)
制造方法	一体化整体式CNC加工 (无缝/无焊)
工作温度范围	-200°C 至 +260°C (-328°F 至 +500°F)
化学抵抗力	通用抵抗力 (除熔融碱金属和元素氟外)
设计类型	内部/外部一体化溢流系统
壁厚	标准 10mm 至 30mm (完全可定制)
表面光洁度	高精度光滑表面 (Ra < 0.8 μm 可选)
尺寸容量	从小型实验室规模到大型工业体积定制构建
端口配置	可选 PFA/PTFE 螺纹端口、法兰连接或溢流堰
认证	洁净室使用的材料安全性和纯度合规
定制选项	尺寸、壁厚、盖子设计、内部挡板和传感器安装座